

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年7月19日(19.07.2018)



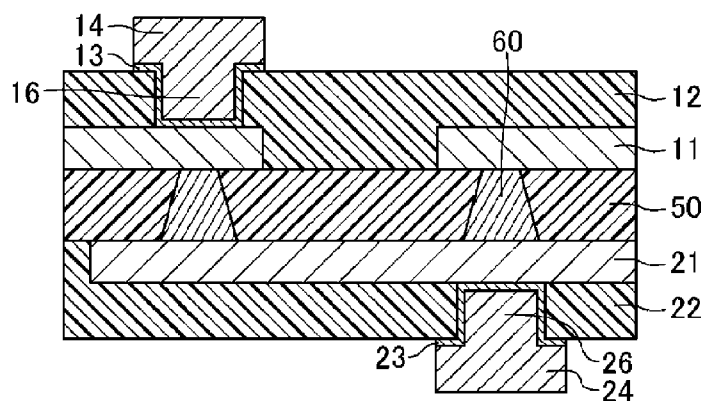
(10) 国際公開番号

WO 2018/131285 A1

- (51) 国際特許分類:
H05K 3/40 (2006.01) *H05K 3/46* (2006.01)
H05K 1/11 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/041053
- (22) 国際出願日: 2017年11月15日(15.11.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2017-004133 2017年1月13日(13.01.2017) JP
- (71) 出願人: 東レエンジニアリング株式会社(TORAY ENGINEERING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1030028 東京都中央区八重洲1丁目3番22号(八重洲龍名館ビル) Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 荒木 勝文 (ARAKI, Katsufumi); 〒3501159 埼玉県川越市中台2丁目19番地2 レイテック株式会社内 Saitama (JP). 金子美晴 (KANEKO, Miharuru); 〒3501159 埼玉県川越市中台2丁目19番地2 レイテック株式会
- 社内 Saitama (JP). 上原 秀雄(UEHARA, Hideo); 〒3501159 埼玉県川越市中台2丁目19番地2 レイテック株式会社内 Saitama (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING FLEXIBLE PRINTED BOARD, AND FLEXIBLE PRINTED BOARD

(54) 発明の名称: フレキシブルプリント基板の製造方法及びフレキシブルプリント基板



(57) Abstract: Provided is a method for producing a flexible printed board, which comprises a step for forming a via hole in a short time without any remaining smear. Specifically, a method for producing a flexible printed board according to the present invention comprises: a step for providing a first photosensitive insulating resin layer on one surface of a first conductive layer; a step for forming a first hole in the first photosensitive insulating resin layer by means of photolithography, said first hole reaching the first conductive layer; and a step for providing a first wiring layer on a surface of the first photosensitive insulating resin layer, said surface being on the reverse side of the surface that is in contact with the first conductive layer. In the step for providing the first wiring layer, the first wiring layer is electrically connected to the first conductive layer by means of a first conductive member that is provided within the first hole.



TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：ビアホール形成をスミアを残さず短時間で行う工程を含むフレキシブルプリント基板の製造方法を提供する。具体的には、フレキシブルプリント基板の製造方法は、第1の導電層の一方の面に第1の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、前記第1の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第1の導電層に達する第1の穴を設ける工程と、前記第1の感光性絶縁樹脂層の、前記第1の導電層に接している面とは反対側の面に第1の配線層を設ける工程とを含み、前記第1の配線層を設ける工程では、前記第1の穴の中に設けられた第1の導電部材によって前記第1の配線層を前記第1の導電層に電氣的に導通させている。

明 細 書

発明の名称：

フレキシブルプリント基板の製造方法及びフレキシブルプリント基板

技術分野

[0001] 本発明は、フレキシブルプリント基板の製造方法及びフレキシブルプリント基板に関するものである。

背景技術

[0002] 電子機器の小型化の要請は近年益々強まっており、電子機器内の部品や部品を搭載する基板を小さくする技術開発が進められている。基板を多層プリント基板とすることで電子機器を小型化することができるため、多層プリント基板の開発が進められている。

[0003] 多層プリント基板では、層の異なる配線同士を接続させるためビアホールを形成し、ビアホール内に導電性の部材を埋設している場合がある。このような場合、以前はビアホールを機械式のドリルで形成していたが、最近ではレーザーにより形成することが多くなっている。

[0004] レーザによるビアホールの穴開けでは、スミアと呼ばれる残渣がビアホールの底やビアホール近傍の表面に残るといった問題があった。スミアが残ったまま後工程を行うと、導通不良及び層間の密着不良の原因となってしまうので、湿式法によってスミアを除去する工程およびスミア残りがいないことを確認する検査工程が穴開け工程の後に設けられるためコスト増となっている。さらに、ビア径が小さくなるとビアホールの底に残ったスミアを除去することが困難になり、スミアが除去されたか否かの検査も困難になり、且つ検査に時間がかかってしまう。この問題を緩和するために特許文献 1，2 に開示されている技術が提案されている。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開 2007-294708 号公報

特許文献2：特開2014-183152号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] しかしながら、特許文献1，2に開示された技術をもってしてもレーザ加工だけではスミアを完全に取り除くことはできず、レーザ加工を行った後に湿式法によってスミアを除去する工程が必要であり、ビア径が小さくなると生じる問題にも対応が不完全で、コストと加工時間が増大してしまうという問題があった。

[0007] 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ビアホール形成をスミアを残さず短時間で行う工程を含むフレキシブルプリント基板の製造方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0008] 上述の課題を解決するフレキシブルプリント基板の製造方法の一態様は、第1の導電層の一方の面に第1の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、前記第1の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第1の導電層に達する第1の穴を設ける工程と、前記第1の感光性絶縁樹脂層の、前記第1の導電層に接している面とは反対側の面に第1の配線層を設ける工程とを含み、前記第1の配線層を設ける工程では、前記第1の穴の中に設けられた第1の導電部材によって前記第1の配線層を前記第1の導電層に電氣的に導通させている。第1の導電層には配線パターンが形成されていてもよい。

[0009] 前記第1の穴は、前記第1の導電層側の開口面積よりも前記第1の配線層側の開口面積の方が小さくてもよい。

[0010] 前記第1の導電層の他方の面には絶縁樹脂フィルムが設けられており、前記絶縁樹脂フィルムの、前記第1の導電層に接している面とは反対側の面に第2の導電層が設けられているとともに、前記第2の導電層の、前記絶縁樹脂フィルムに接した面とは反対側の面に第2の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、前記第2の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第2の導電層に達する第2の穴を設ける工程と、前記第2の感光性絶縁樹脂層

の、前記第2の導電層に接している面とは反対側の面に第2の配線層を設ける工程とをさらに含み、前記第2の配線層を設ける工程では、前記第2の穴の中に設けられた第2の導電部材によって前記第2の配線層を前記第2の導電層に電氣的に導通させていてもよい。第2の導電層には配線パターンが形成されていてもよい。また、絶縁樹脂フィルムに貫通孔を設けて第1の導電層と第2の導電層とを導通させてもよい。

[0011] 前記第2の穴は、前記第2の導電層側の開口面積よりも前記第2の配線層側の開口面積の方が小さくてもよい。

[0012] 前記第1の配線層の、前記第1の感光性絶縁樹脂層に接している面とは反対側の面に第3の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、前記第3の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第1の配線層に達する第3の穴を設ける工程と、前記第3の感光性絶縁樹脂層の、前記第1の配線層に接している面とは反対側の面に第3の配線層を設ける工程とをさらに含み、前記第3の配線層を設ける工程では、前記第3の穴の中に設けられた第3の導電部材によって前記第3の配線層を前記第1の配線層に電氣的に導通させていてもよい。

[0013] 前記第1の穴と前記第2の穴とは同時に設けられてもよい。

[0014] また、上述の課題を解決するフレキシブルプリント基板の一態様は、絶縁樹脂フィルムと、前記絶縁樹脂フィルムの上に設けられた導電層と、前記導電層の上に設けられた感光性絶縁樹脂層と、前記感光性絶縁樹脂層の上に設けられた配線層とを備え、前記感光性絶縁樹脂層は前記導電層に達する穴を備えており、前記穴の中には前記導電層と前記配線層とを電氣的に導通させる導電部材が配されている。

[0015] 前記感光性絶縁樹脂層は光照射によって硬化しており、前記穴は前記導電層側の開口面積よりも前記配線層側の開口面積の方が小さくてもよい。

発明の効果

[0016] 感光性絶縁樹脂層を用い、フォトリソグラフィによって穴を開けるので、スミアが残らず、低コストで信頼性の高いビア接続を備えたフレキシブルプ

リント基板を作成することができる。

図面の簡単な説明

[0017] [図1] 2層CCLの断面を示す模式図である。

[図2] 層間接続がなされた2層配線パターンを有するFPCの模式的な断面図である。

[図3] ある実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図4] ある実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図5] ある実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図6] ある実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図7] ある実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図8] 別の実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図9] 別の実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図10] 別の実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図11] 別の実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図12] 別の実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

[図13] 他の実施形態に係る製法の一工程終了後のFPCの模式的な断面図である。

発明を実施するための形態

[0018] 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の好ましい実施形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意図するものではない。以下の図面においては、説明の簡潔化のため、実質的に同一の機能を有する構成要素を同一の参照符号で示す。また、以下の説明における上下関係は、図面における上下の関係を指している。

[0019] (実施形態1)

実施形態1に係るフレキシブルプリント基板の製造方法を図1から図7に基づいて説明する。

[0020] 図1に示すように、まず絶縁樹脂フィルム50の両面に金属層10, 20を設けたフレキシブル2層CCLを用意する。絶縁樹脂フィルム50は例えばポリイミドフィルムからなり、曲げられるように厚みは $5\mu\text{m}$ ~ $50\mu\text{m}$ 程度であることが好ましい。金属層10, 20は金属薄膜からなり、コストおよび導電性の高さから銅薄膜であることが好ましく、その厚みは $0.2\mu\text{m}$ ~ $2\mu\text{m}$ であることが好ましい。

[0021] この2層CCLの両面に、配線パターンを有する第1の導電層11及び第2の導電層21を形成すると共に、絶縁樹脂フィルム50に貫通孔を設けその貫通孔を導電物質によって埋めて第1の導電層11及び第2の導電層21の間の導通を確保する(図2)。このような層間接続されたFPCを作成するには、例えば、金属層20をエッチングして穴を形成し、その穴から露出した絶縁樹脂フィルム50の部分をエッチングにより貫通孔を形成し、その貫通孔にめっきにより銅を埋め込んだ後、金属層10, 20に対してパターンエッチングを行って配線パターンを形成し、さらにその配線パターン上に金属めっきを行って導電層厚みを大きくして第1の導電層11及び第2の導電層21を形成する、という方法で行えばよい。なお、この方法は1つの例であり、別の方法で行っても構わない。

[0022] 次に、図3に示すように、第1の導電層11の上面(絶縁樹脂フィルム50に接した面とは反対側の面)に第1の感光性絶縁樹脂層12を設けるとと

もに、第2の導電層21の下面（絶縁樹脂フィルム50に接した面とは反対側の面）に第2の感光性絶縁樹脂層22を設ける。第1及び第2の感光性絶縁樹脂層12, 22は、例えば感光性ポリイミドフィルムを貼り合わせて形成したり、感光性のワニスを塗布して形成したりすればよく、その厚みは5 μm ~ 50 μm 程度が好ましい。

[0023] それから図4に示すように、フォトリソグラフィによって第1の感光性絶縁樹脂層12に第1の穴15を、第2の感光性絶縁樹脂層22に第2の穴25を設ける。即ち、第1の穴15, 第2の穴25の部分のみが硬化しないようにマスク・露光を行って、薬液によって除去することにより、第1の穴15, 第2の穴25を形成する。ビアホールである第1の穴15は第1の導電層11にまで達しており、第2の穴25は第2の導電層21にまで達している。

[0024] さらに図5に示すように第1及び第2の穴15, 25を形成した第1及び第2の感光性絶縁樹脂層12, 22の露出している面の全面にスパッタ等により導電薄膜13, 23を形成する。そして、フォトリソグラフィにより両面にパターンマスクを形成し、めっきによって、第1の穴15を第1の導電部材16を用いて埋設し、第2の穴25を第2の導電部材26を用いて埋設すると共に、第1の配線層14及び第2の配線層24をそれぞれ第1の感光性絶縁樹脂層12の上（第1の導電層11に接している面とは反対側）、第2の感光性絶縁樹脂層22の下（第2の導電層21に接している面とは反対側）に設ける（図6）。その後、第1の配線層14の直下及び第2の配線層24の直上に存在している導電薄膜13, 23のみを残して、それ以外の導電薄膜13, 23をエッチングによって除去することにより、図7に示す4層の配線パターンが積層されて、隣接する上下の配線パターン同士が接続されたフレキシブルプリント基板が出来上がる。

[0025] 本実施形態では、第1の導電層11と第1の配線層14との間、及び第2の導電層21と第2の配線層24との間にそれぞれ第1の感光性絶縁樹脂層12及び第2の感光性絶縁樹脂層22を介在させることにより、第1の導電

層 1 1 と第 1 の配線層 1 4 との間のビア接続及び第 2 の導電層 2 1 と第 2 の配線層 2 4 との間のビア接続のための第 1 の穴 1 5 及び第 2 の穴 2 5 をフォトリソグラフィによって形成することができる。このように第 1 の穴 1 5 及び第 2 の穴 2 5 をフォトリソグラフィによって形成すると、未硬化の感光性絶縁樹脂は薬液に溶解して確実に取り除かれるため、穴の中及び第 1 の感光性絶縁樹脂層 1 2 及び第 2 の感光性絶縁樹脂層 2 2 の表面に感光性絶縁樹脂の残渣が残らず、ビア接続が確実に行われ、第 1 の配線層 1 4 及び第 2 の配線層 2 4 も信頼性の高い配線パターンとすることができる。さらに残渣が残らないので穴の形成後の検査も容易に行うことができ、形成条件によっては検査を省略することも可能となり、製造時間が短縮でき、コストも下げることができる。また、リソグラフィによる穴開けは、基板の全ての穴の加工を一括して行えるため、同様に製造時間が短縮でき、コストも下げることができる。そして、第 1 と第 2 の感光性絶縁樹脂層 1 2, 2 2 や、第 1 と第 2 の導電層 1 1, 2 1、第 1 と第 2 の配線層 1 4, 2 4 の材料の種類や厚みなどを適切に選択することにより、薄くて曲げやすいフレキシブルプリント基板を製造することが可能になる。

[0026] (実施形態 2)

実施形態 2 は実施形態 1 により作成された図 7 に示すフレキシブルプリント基板の第 1 の配線配線層 1 4 の上に、さらにもう一つの配線層を形成しているので、図 7 に示されたフレキシブルプリント基板以降の製造方法について以下に説明する。

[0027] 本実施形態では、まず、図 7 に示すフレキシブルプリント基板の第 1 の配線配線層 1 4 の上（第 1 の感光性絶縁樹脂層 1 2 に接している面とは反対側）に、図 8 に示すように第 3 の感光性絶縁樹脂層 3 2 を設ける。

[0028] 次に図 9 に示すように、フォトリソグラフィによって第 3 の感光性絶縁樹脂層 3 2 に第 3 の穴 3 5 を設ける。ビアホールである第 3 の穴 3 5 は第 1 の配線層 1 4 にまで達している。

[0029] それから図 10 に示すように第 3 の穴 3 5 を形成した第 3 の感光性絶縁樹脂

脂層 3 2 の露出している上側の面の全面にスパッタ等により導電薄膜 3 3 を形成する。そして、フォトリソグラフィにより導電薄膜 3 3 の上にパターンマスクを形成し、めっきによって、第 3 の穴 3 5 を第 3 の導電部材 3 6 を用いて埋設すると共に、第 3 の配線層 3 4 を第 3 の感光性絶縁樹脂層 3 2 の上（第 1 の配線層 1 4 に接している面とは反対側）に設ける（図 1 1）。その後、第 3 の配線層 3 4 の直下に存在している導電薄膜 3 3 のみを残して、それ以外の導電薄膜 3 3 をエッチングによって除去することにより、図 1 2 に示す 5 層の配線パターンを積層し、隣接する上下の配線パターン同士が接続されたフレキシブルプリント基板が出来上がる。

[0030] 本実施形態においても実施形態 1 と同じ効果を奏する。また、同様の方法で第 2 の配線層 2 4 の表面にさらにもう一つの配線層を形成してもよく、同じようにして両面にさらに配線層を重ねていても構わない。

[0031] （実施形態 3）

実施形態 3 は、実施形態 1 とは第 1 の穴 1 5 及び第 2 の穴 2 5 の形状が異なっており、従って第 1 の導電部材 1 6 及び第 2 の導電部材 2 6 の形状が異なっていて、それ以外は実施形態 1 と同じであるので、実施形態 1 とは異なっている点について以下に説明をする。

[0032] 図 1 3 に示すように、本実施形態では第 1 の穴 1 9 は第 1 の導電層 1 1 側の開口面積よりも第 1 の配線層 1 4 側の開口面積の方が小さくなっている。同様に第 2 の穴 2 9 は第 2 の導電層 2 1 側の開口面積よりも第 2 の配線層 2 4 側の開口面積の方が小さくなっている。即ち第 1 の穴 1 9 及び第 2 の穴 2 9 が形成された時点では、これらの穴 1 9, 2 9 は開口に向かうに連れて径が小さくなるテーパ形状を有している。第 1 の穴 1 9 及び第 2 の穴 2 9 がこのような形状を有しているので、これらの穴 1 9, 2 9 に埋設された第 1 の導電部材 1 8 及び第 2 の導電部材 2 8 は実施形態 1 に比較して第 1 の感光性絶縁樹脂層 1 2 及び第 2 の感光性絶縁樹脂層 2 2 から抜け落ちにくくなっている。従って、第 1 の配線層 1 4 及び第 2 の配線層 2 4 は強固に形成されて高い信頼性を有している。なお、このような第 1 の穴 1 9 及び第 2 の穴 2 9

の形状を形成するには、例えば、第1の感光性絶縁樹脂層12及び第2の感光性絶縁樹脂層22の原材料を光照射により硬化する樹脂とし、フォトリソグラフィの工程において光の照射量を少なめにコントロールする方法が考えられる。そうすると、穴を形成するためのマスクの端部において、端部の外側の光が照射される部分の感光性絶縁樹脂層は底に近づくにつれて硬化が不十分となり、穴を開けるための現像において底側に近づくほどマスクされていない部分も薬液に溶解するようになるからである。

[0033] (その他の実施形態)

上述の実施形態は本願発明の例示であって、本願発明はこれらの例に限定されず、これらの例に周知技術や慣用技術、公知技術を組み合わせたり、一部置き換えたりしてもよい。また当業者であれば容易に思いつく改変発明も本願発明に含まれる。

[0034] 最初に用意する材料は2層CCLに限定されず、3層CCLや片面のみに金属層を備えたCCLであってもよい。また、銅箔であってもよい。金属層が1層のみの場合や銅箔をスタート材料とする場合、それらの上にのみ感光性絶縁樹脂層や配線層を積層していてもよいし、下面側にも感光性絶縁樹脂層や配線層を積層してもよく、それらが薄膜の場合、PET等の支持材によって支持を行ったり、あらかじめ積層されている材料を用いても構わない。

[0035] 各感光性絶縁樹脂層の感光性は、ポジ型であってもネガ型であっても構わない。また、各感光性絶縁樹脂層は同じもの（例えば同じ品番の感光性カバレイフィルム）を用いてもよいし、種類や材料、厚みが異なるものをそれぞれ用いても構わない。

[0036] 第1の穴、第2の穴、第3の穴を各導電部材によって埋めてしまう必要はない。例えば、各導電部材として導電薄膜を用いてその導電薄膜と、第1の配線層、第2の配線層、第3の配線層とが電氣的に導通している構造としても構わない。

[0037] 第1の穴と第2の穴は同じフォトリソグラフィ工程によって同時に形成す

ると、コストが低下するため好ましいが、別々に形成しても構わない。

[0038] 各穴に形成する導電薄膜は、例えば、ニクロムスパッタや、ニクロムスパッタと銅スパッタの併用により厚みが $2\mu\text{m}$ 以下に形成することが好ましいが、この形成方法に限定されることはなく、公知の種々の導電薄膜形成方法を用いることができる。また、導電薄膜の上に設けるめっき層は特に限定されないが、例えば銅を用いることが挙げられる。この場合、導電部材はめっきによる銅ということになる。

[0039] 実施形態3における穴の形成方法は、別の方法を用いても構わない。

符号の説明

[0040]	1 1	第1の導電層
	1 2	第1の感光性絶縁樹脂層
	1 4	第1の配線層
	1 5、1 9	第1の穴
	1 6、1 8	第1の導電部材
	2 1	第2の導電層
	2 2	第2の感光性絶縁樹脂層
	2 4	第2の配線層
	2 5、2 9	第2の穴
	2 6、2 8	第2の導電部材
	3 2	第3の感光性絶縁樹脂層
	3 4	第3の配線層
	3 5	第3の穴
	3 6	第3の導電部材
	5 0	絶縁樹脂フィルム

請求の範囲

- [請求項1] 第1の導電層の一方の面に第1の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、
- 前記第1の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第1の導電層に達する第1の穴を設ける工程と、
- 前記第1の感光性絶縁樹脂層の、前記第1の導電層に接している面とは反対側の面に第1の配線層を設ける工程と
- を含み、
- 前記第1の配線層を設ける工程では、前記第1の穴の中に設けられた第1の導電部材によって前記第1の配線層を前記第1の導電層に電氣的に導通させている、フレキシブルプリント基板の製造方法。
- [請求項2] 前記第1の穴は、前記第1の導電層側の開口面積よりも前記第1の配線層側の開口面積の方が小さい、請求項1に記載されているフレキシブルプリント基板の製造方法。
- [請求項3] 前記第1の導電層の他方の面には絶縁樹脂フィルムが設けられており、
- 前記絶縁樹脂フィルムの、前記第1の導電層に接している面とは反対側の面に第2の導電層が設けられているとともに、
- 前記第2の導電層の、前記絶縁樹脂フィルムに接した面とは反対側の面に第2の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、
- 前記第2の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第2の導電層に達する第2の穴を設ける工程と、
- 前記第2の感光性絶縁樹脂層の、前記第2の導電層に接している面とは反対側の面に第2の配線層を設ける工程と
- をさらに含み、
- 前記第2の配線層を設ける工程では、前記第2の穴の中に設けられた第2の導電部材によって前記第2の配線層を前記第2の導電層に電氣的に導通させている、請求項1又は2に記載されているフレキシブ

ルプリント基板の製造方法。

[請求項4] 前記第2の穴は、前記第2の導電層側の開口面積よりも前記第2の配線層側の開口面積の方が小さい、請求項3に記載されているフレキシブルプリント基板の製造方法。

[請求項5] 前記第1の配線層の、前記第1の感光性絶縁樹脂層に接している面とは反対側の面に第3の感光性絶縁樹脂層を設ける工程と、

前記第3の感光性絶縁樹脂層に、フォトリソグラフィによって前記第1の配線層に達する第3の穴を設ける工程と、

前記第3の感光性絶縁樹脂層の、前記第1の配線層に接している面とは反対側の面に第3の配線層を設ける工程と

をさらに含み、

前記第3の配線層を設ける工程では、前記第3の穴の中に設けられた第3の導電部材によって前記第3の配線層を前記第1の配線層に電氣的に導通させている、請求項1から4のいずれか一つに記載されているフレキシブルプリント基板の製造方法。

[請求項6] 前記第1の穴と前記第2の穴とは同時に設けられる、請求項3又は4に記載されているフレキシブルプリント基板の製造方法。

[請求項7] 絶縁樹脂フィルムと、

前記絶縁樹脂フィルムの上に設けられた導電層と、

前記導電層の上に設けられた感光性絶縁樹脂層と、

前記感光性絶縁樹脂層の上に設けられた配線層と

を備え、

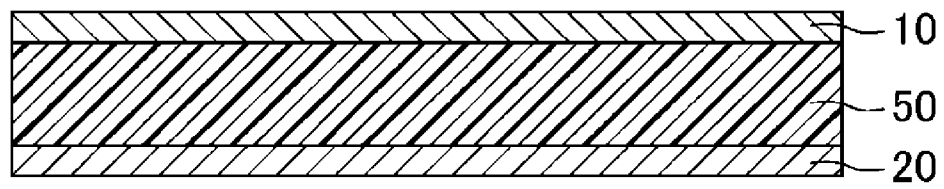
前記感光性絶縁樹脂層は前記導電層に達する穴を備えており、

前記穴の中には前記導電層と前記配線層とを電氣的に導通させる導電部材が配されている、フレキシブルプリント基板。

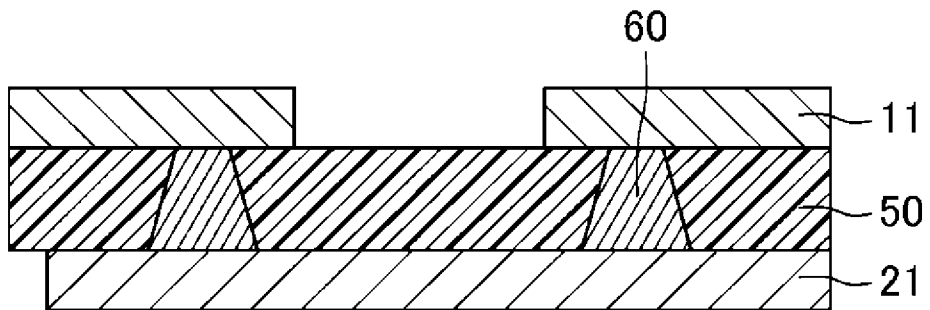
[請求項8] 前記感光性絶縁樹脂層は光照射によって硬化しており、

前記穴は前記導電層側の開口面積よりも前記配線層側の開口面積の方が小さい、請求項7に記載されているフレキシブルプリント基板。

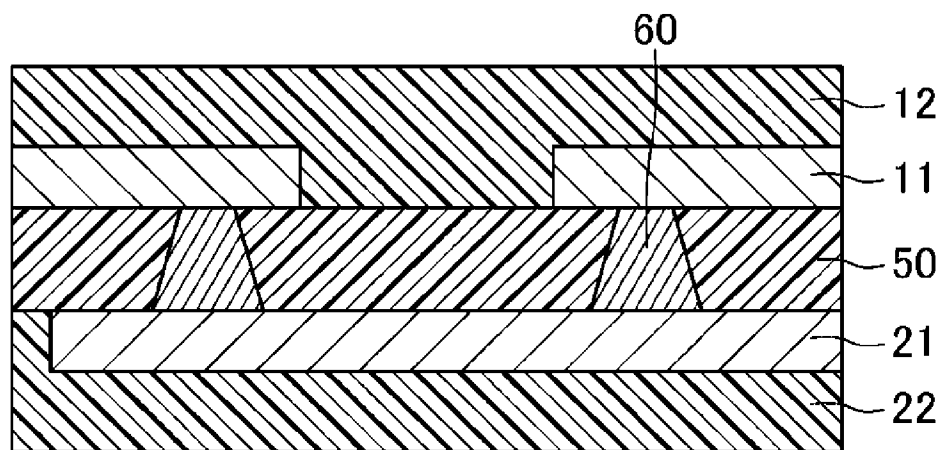
[図1]



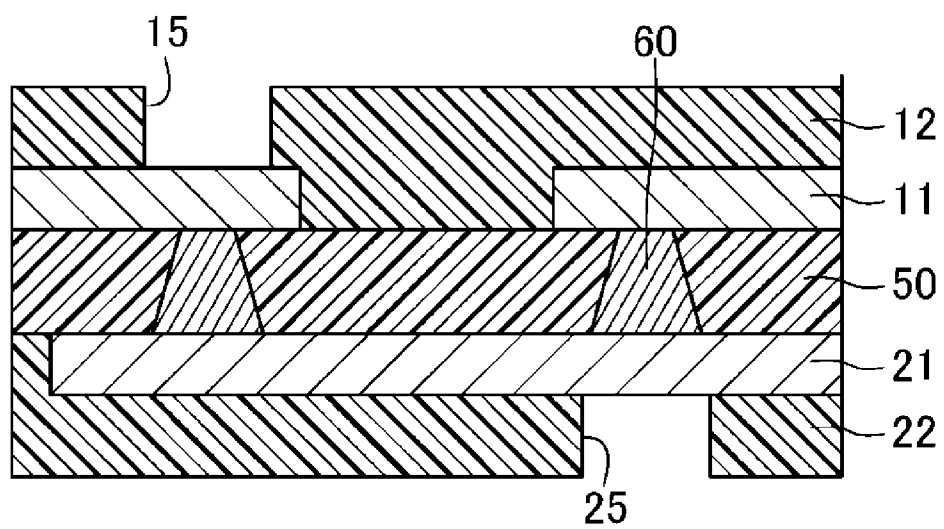
[図2]



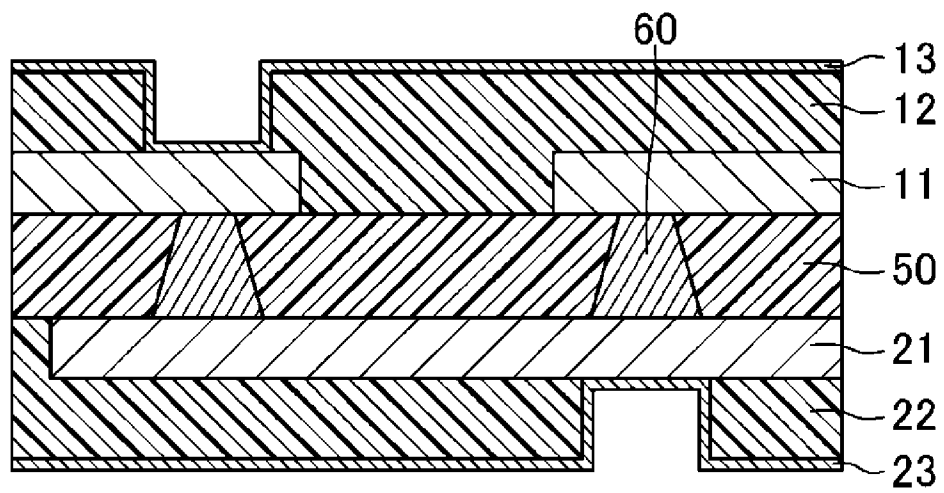
[図3]



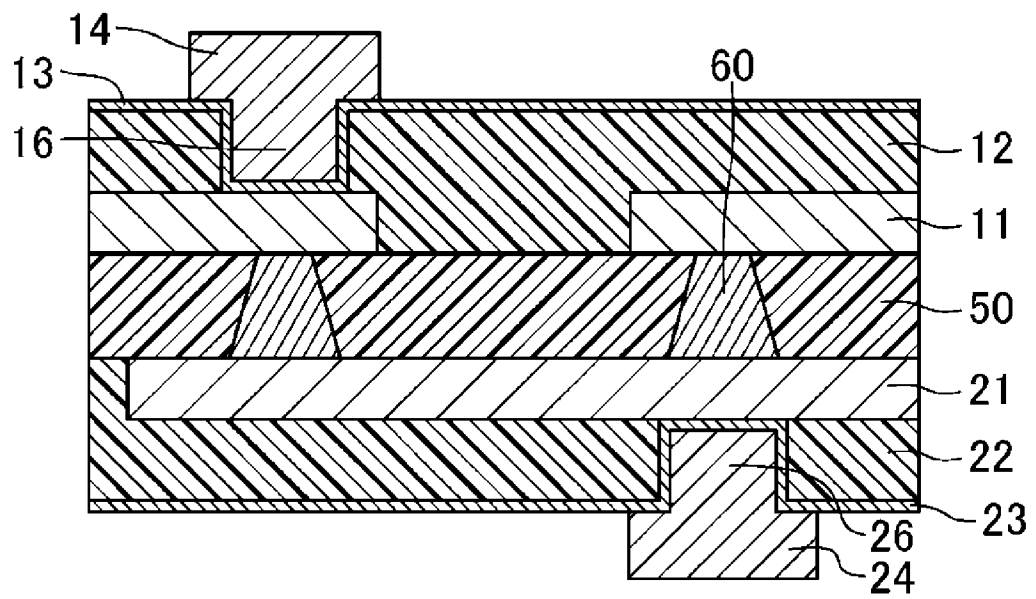
[図4]



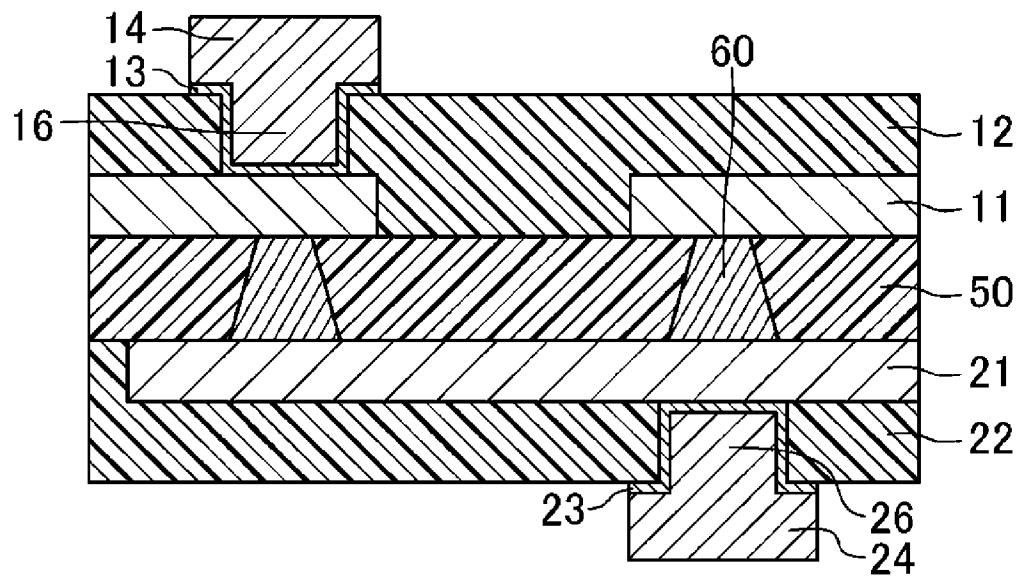
[図5]



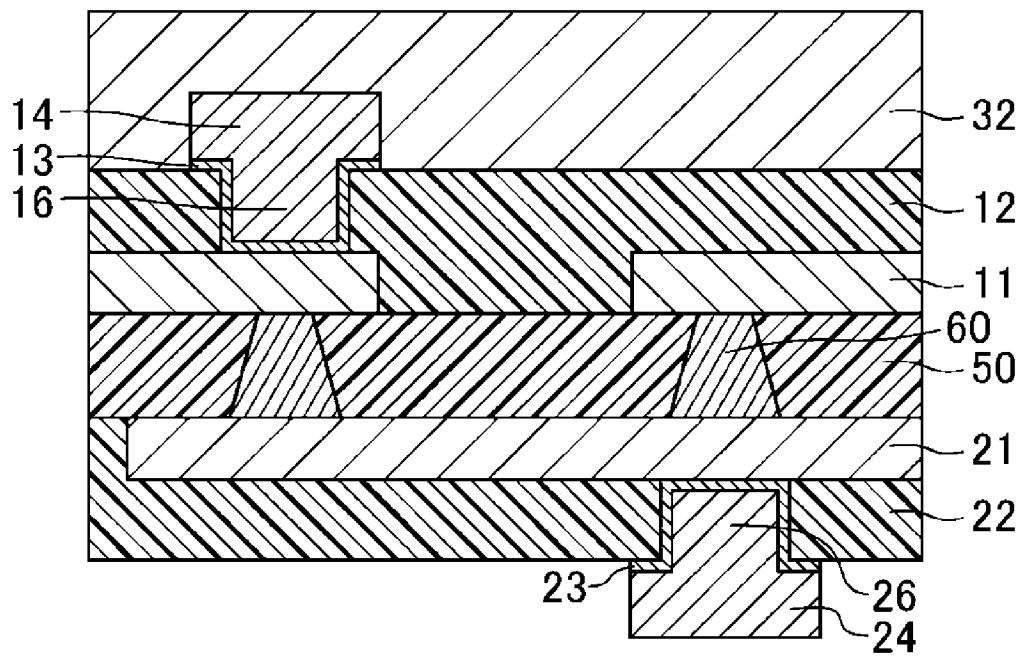
[図6]



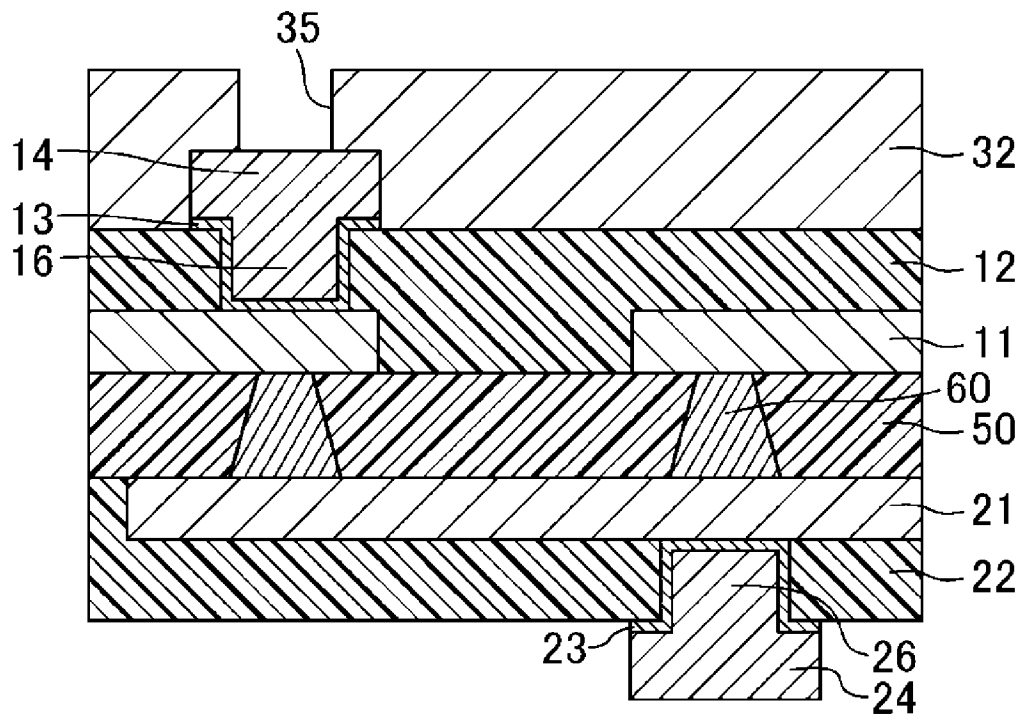
[図7]



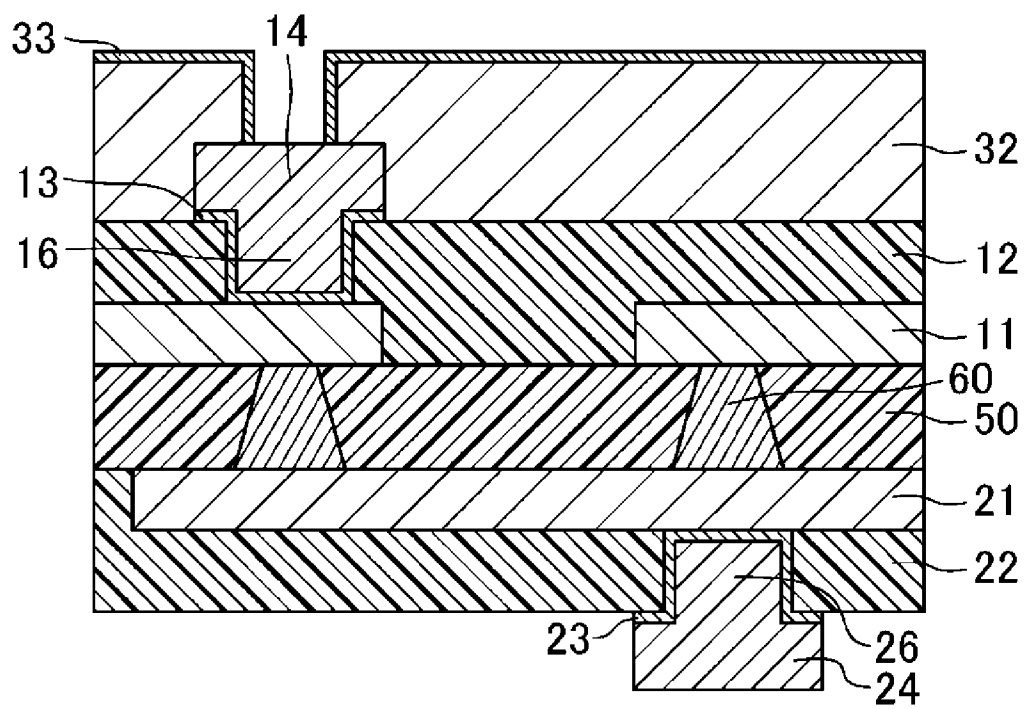
[図8]



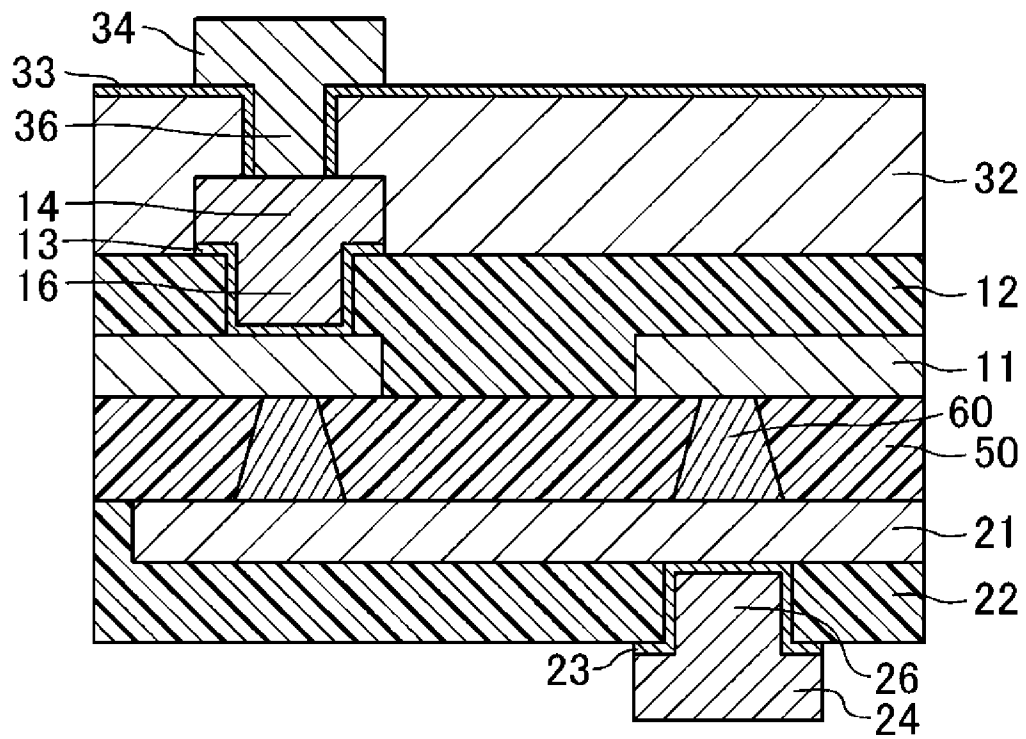
[図9]



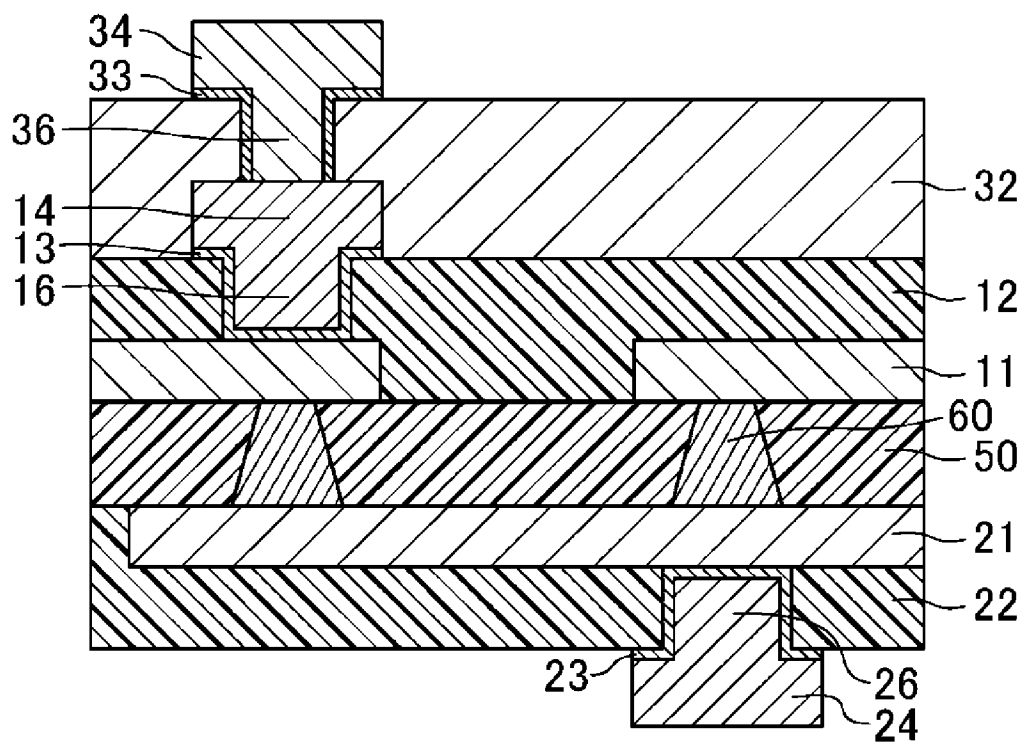
[図10]



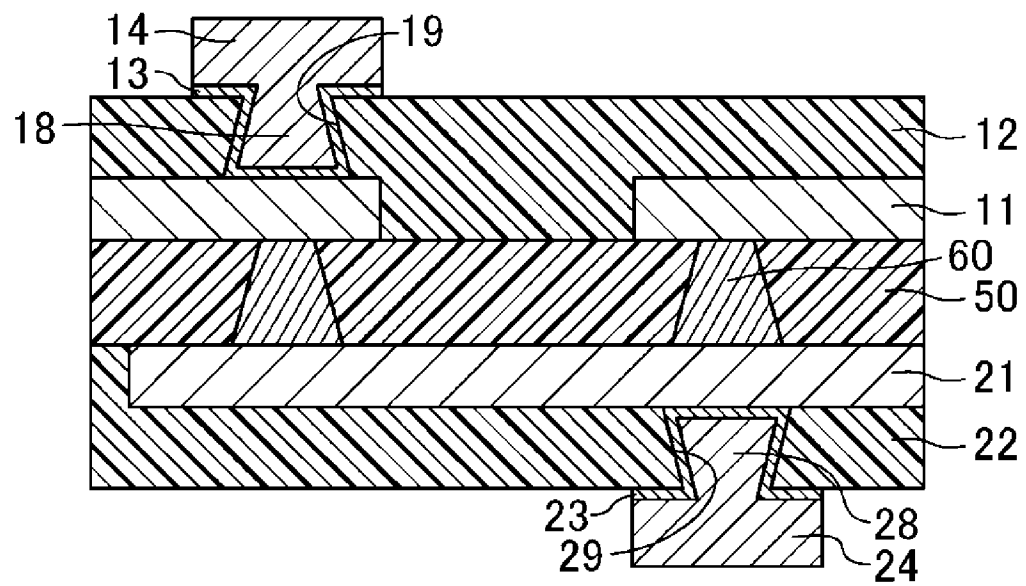
[図11]



[図12]



[図13]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/041053

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. H05K3/40 (2006.01) i, H05K1/11 (2006.01) i, H05K3/46 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H05K3/40, H05K1/11, H05K3/46

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2017
Registered utility model specifications of Japan	1996-2017
Published registered utility model applications of Japan	1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 11-31885 A (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) 02 February 1999, paragraphs [0015], [0017], fig. 1 (Family: none)	1, 3, 5-7 2, 4, 8
X Y	JP 11-145621 A (SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.) 28 May 1999, paragraphs [0039], [0043]-[0074], fig. 6-7 (Family: none)	1, 5, 7 2, 8
X Y	JP 9-64543 A (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) 07 March 1997, paragraphs [0006]-[0012], fig. 1 (Family: none)	1, 5, 7 2, 8



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
19 January 2018 (19.01.2018)

Date of mailing of the international search report
30 January 2018 (30.01.2018)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/041053

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 11-97847 A (KYOCERA CORP.) 09 April 1999, paragraphs [0024]-[0025], fig. 1 (Family: none)	2, 4, 8
A	WO 2013/145043 A1 (PANASONIC IP MANAGEMENT CO., LTD.) 03 October 2013 & US 2014/0124777 A1 & CN 103597916 A	1-8
A	JP 2016-133661 A (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) 25 July 2016 (Family: none)	1-8
A	JP 4-179297 A (HITACHI CABLE, LTD.) 25 June 1992 (Family: none)	1-8

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H05K3/40(2006.01)i, H05K1/11(2006.01)i, H05K3/46(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H05K3/40, H05K1/11, H05K3/46

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 11-31885 A（日立化成工業株式会社）1999.02.02, 段落 [0015], [0017], 図1（ファミリーなし）	1, 3, 5-7 2, 4, 8
X Y	JP 11-145621 A（住友金属工業株式会社）1999.05.28, 段落 [0039], [0043]-[0074], 図6-7（ファミリーなし）	1, 5, 7 2, 8
X Y	JP 9-64543 A（日立化成工業株式会社）1997.03.07, 段落 [0006]-[0012], 図1（ファミリーなし）	1, 5, 7 2, 8

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

19.01.2018

国際調査報告の発送日

30.01.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

梅本 章子

5D

2949

電話番号 03-3581-1101 内線 3551

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 11-97847 A (京セラ株式会社) 1999. 04. 09, 段落[0024]-[0025], 図 1 (ファミリーなし)	2, 4, 8
A	WO 2013/145043 A1 (パナソニック I P マネジメント株式会社) 2013. 10. 03 & US 2014/0124777 A1 & CN 103597916 A	1-8
A	JP 2016-133661 A (日立化成株式会社) 2016. 07. 25 (ファミリーなし)	1-8
A	JP 4-179297 A (日立電線株式会社) 1992. 06. 25 (ファミリーなし)	1-8